



森・濱田松本法律事務所 / ウエストロー・ジャパン共催セミナー

中国における知的財産権／ 増大する知的財産訴訟のリスク及びその対応～進行する法改正も踏まえ

中国における特許の出願件数は急増しており、2011年にそれまで最多であった米国の特許出願件数の年間約50万件を越え、2012年には年間約70万件に達しました。実用新案及び意匠の出願件数も合わせると年間約200万件に上りました。また商標出願数も依然増加しており、2012年には年間150万件を超えました。これに伴い権利が許諾される件数も増加しており、やはり数年後は米国を上回る水準になると予想されます。

低賃金・低コストを武器に急成長を続けて来た中国経済の成長率は、賃金の上昇、資源・環境問題の悪化等により鈍化しており、中国では産業構造をよりイノベーションを重視した方向に転換することにより、さらなる経済成長を目指そうとしています。具体的には、中国での研究開発費を増大させコア技術の創作を促すと共に、これらの技術の特許を始めとする知的財産として保護しようとするものです。このような政策の下、出願件数が増加していることは上記のとおりですが、権利行使の場面でも、権利保護を強化する方向性を打ち出しており、商標法、そして特許法の改正作業が現在進行中です。改正項目は多岐にわたりますが、濫用的な権利行使を抑制する規定を設ける一方で、悪意の侵害者に対しては、最大で3倍の懲罰的損害賠償を命じることができる規定の新設が検討されており、実現する可能性が高い状況です。

中国における特許、実用新案及び意匠の侵害訴訟の受理件数は年々増加し、2011年には既に約8000件に達しています（なお同年の商標権侵害訴訟の受理件数は約1万3000件）。上記の出願数の増大、権利保護の強化を踏まえると、今後さらに侵害訴訟の件数が増加すると予想されます。したがって今後は、従来から大きな問題となっている商標の抜け駆け登録（冒認登録）や模倣品の流通といった日本企業の権利が侵害されるリスクに加え、逆に日本企業が中国において第三者の特許権や実用新案権を侵害しているとして紛争に巻き込まれるリスクにも対処していく必要があります。これまでも日本企業が中国において特許権侵害訴訟の被告とされ、人民法院から数億円規模の賠償を命じられたケースも生じておりましたが、今後、このような侵害訴訟リスクが大幅に増加するものと予想されるためです。しかも中国の民事訴訟は、進行が非常に早く、翻訳等の作業が必要となる外国企業を当事者とする涉外訴訟、かつ技術的に難解な争点を含む特許侵害訴訟においても、数ヶ月程度で第一審の審理が終了するのが通例であり、中国において突如知的財産権侵害訴訟を提起され、応訴を余儀なくされた場合の負担は、非常に大きいといえます。

そこで本セミナーでは、中国における特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の法制度の重要な部分について、近時の改正議論も踏まえながら解説すると共に、最新の出願及び権利行使の状況も念頭において侵害訴訟のリスクにどのように備え、また現実に侵害訴訟が提起された場合にどのように対応すればよいのか解説する予定です。

日 時：2013年7月26日（金）
セミナー 13:30～17:30（開場 13:00）
会 場：トムソン・ロイター 赤坂オフィス セミナールーム
東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー30階
<http://www.biztower.net/access/img/access.pdf>
主 催：森・濱田松本法律事務所
ウエストロー・ジャパン株式会社
定 員：50名
申 込 先：Webサイトよりお申し込みください。
<http://www.westlawjapan.com/event/seminar/130726.html>
参 加 費：無料

プログラム
13:30～15:00
中国における知的財産権法制の基礎
15:00～15:20
Westlaw Chinaにおける知的財産権関連のコンテンツ
および機能
15:20～15:40
コーヒーブレイク
15:40～17:10
中国における知的財産権訴訟リスクへの対応策
17:10～17:30
質疑応答

本セミナーは、企業の法務部門・知財部門のご責任者ならびに実務ご担当者を対象としています。応募多数の場合は抽選にて決定しますが、一社につき2名様までとさせていただきます。個人のお客様や同業者の方につきましてはご参加をお断りしますので、予めご了承ください。

申し込み多数の場合は抽選の上、受講券をご登録のメールアドレスにお送りします。

（プログラム構成・内容は変更となる場合があります。予めご了承ください）

中国における知的財産権／ 増大する知的財産訴訟のリスク及びその対応～進行する法改正も踏まえ

プログラム

13:30～15:00 中国における知的財産権法制の基礎

冒頭に述べた出願及び権利行使の現状並びに今後の方向性についてご紹介すると共に、中国における特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の法制度の重要な部分について、近時の改正議論も踏まえながら基本から解説します。

講師：森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 小野寺 良文

15:00～15:20 Westlaw Chinaにおける知的財産権関連のコンテンツおよび機能

いまや中国は知的財産権に関しては世界一の訴訟大国となっており、中国で事業展開する日本企業等にとりましては、法令情報のみならず判例情報のニーズも高まってきています。そこで、今回は法令、判例の収録数がともに中国一を誇るWestlaw Chinaにおける知的財産権に関するコンテンツおよびアラートなどの便利な機能をご紹介します。

講師：ウエストロー・ジャパン株式会社 コンサルティンググループ 袁 藝

15:20～15:40 コーヒーブレイク

15:40～17:10 中国における知的財産権訴訟リスクへの対応策

中国における知的財産権制度侵害訴訟のリスクにどのように備え、また現実に侵害訴訟が提起された場合にどのように対応すればよいのか、知的財産権訴訟制度の基本的な知識を紹介した上で、典型的なケースを時系列に沿って紹介しながら、どのように対応していったらよいか具体的に解説する予定です。

講師：森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士 小野寺 良文

17:10～17:30 質疑・応答

(プログラム構成・内容は変更となる場合があります。予めご了承ください)

講師紹介 森・濱田松本法律事務所

パートナー弁護士 小野寺 良文(おのでら よしふみ)

同事務所の知的財産プラクティスグループ、中国・アジアプラクティスグループのパートナー。2000年に同事務所に入所以来一貫して、特許、商標、著作権等、知的財産法関連の訴訟、仲裁及びライセンス等の案件を担当。化学・生物学のバックグラウンドを有し、これまでに医薬品、バイオテクノロジー、半導体、情報機器、自動車、業務用ソフトウェア、ゲームソフト等の多様な技術分野に関する技術的専門性の高い案件を数多く手掛けている。中国、アジア諸国に関連する案件の経験も豊富である。2007年より青山学院大学法科大学院客員教授(知的財産法)も兼務。

ウエストロー・ジャパン株式会社

コンサルティンググループ 袁 藝(エンイ)

法律事務所、大手企業、官公庁、大学・法科大学院を対象に〈Westlaw China〉関連の講習及びトレーニングを担当。東海大学法科大学院、駿河台大学法科大学院、専修大学法学部で兼任講師として国際私法講義を担当。

ウエストロー・ジャパン株式会社

商品詳細:www.westlawjapan.com お問い合わせ:info@westlawjapan.com 0120-100-482 (月～金 9:00～18:00)



ウエストロー・ジャパン株式会社は、新日本法規出版株式会社とトムソン・ロイターの合併会社です。

新日本法規出版株式会社



THOMSON REUTERS

森・濱田松本法律事務所

MORI HAMADA & MATSUMOTO

WLI062_201306_FD